i-GaAs/*n*-GaAs エピタキシャル構造における コヒーレント LO フォノン-プラズモン結合モードからの テラヘルツ電磁波発生ダイナミクス 住岡隆裕, 竹内日出雄, 中山正昭

大阪市立大学大学院工学研究科電子情報系専攻

Dynamics of terahertz radiation from coherent LO phonon-plasmon coupled modes in *i*-GaAs/*n*-GaAs epitaxial structures T. Sumioka, H. Takeuchi, and M. Nakayama Department of Applied Physics, Osaka City University

We have investigated the dynamical properties of terahertz radiation from coherent longitudinal optical phonon-plasmon coupled (LOPC) modes in an undoped GaAs/n-type GaAs (i-GaAs/n-GaAs) epitaxial structure using time-domain terahertz spectroscopy. It was conformed that the frequencies of the lower and upper LOPC modes depend on a photogenerated carrier density and agree with the calculated dispersion relations. We analyzed the dynamics of the LOPC modes with a time partitioning Fourier transform method. As a result, we estimated that the lifetime of the LOPC mode is about 60 fs. In addition, it was found that the peak frequency of the LOPC modes shifts toward a higher frequency side with an increasing in delay time. We concluded that the frequency shifts reflect the photogenerated carrier transport process from the *i*-GaAs layer to the *n*-GaAs layer.

1.序論

極性半導体中において, LO フォノンはプ ラズモンと結合し、LO フォノン-プラズモ ン結合(LOPC)モードを形成することがよく 知られている[1]。LOPC モードは上分枝 [LOPC(+)]と下分枝[LOPC(-)]から構成され, それぞれの周波数は電子濃度依存性を持つ。 このことから、周波数可変 THz 電磁波放射 源への応用が期待できる。1966 年に Mooradian と Wright が n型 GaAs 結晶を対象 としてラマン散乱による最初の LOPC モー ドの実験結果を報告している[2]。これ以降, 時間幅がフェムト秒オーダーである超短パ ルスレーザーの発展に伴い、ポンプ・プロ ーブ分光法やテラヘルツ時間領域分光法に おいても LOPC モードの観測が報告されて いる[3, 4]。我々もノンドープ GaAs/n 型 GaAs (*i*-GaAs/*n*-GaAs) エピタキシャル構造 を試料として, テラヘルツ時間領域分光法 による LOPC モードからの THz 電磁波放射 の観測を報告している[5]。しかし、LOPC モードの発生ダイナミクスについては詳細

な研究が行われていない。本研究では, *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造を試料として,時間分 解テラヘルツ電磁波の励起強度依存性を測 定し,LOPC モードを確認するとともに, 時間分割フーリエ変換を用いて,コヒーレ ントLOPC モードのダイナミクスについて 解析した。

2.試料構造と実験方法

本研究で用いた試料は、(001)面方位半絶 縁性 GaAs 基板上に有機金属気相エピタキ シー法によって作製された *i*-GaAs(500 nm)/*n*-GaAs(3 µm, 3×10¹⁸ cm³)エピタキシャ ル構造である。この構造では、表面フェル ミ準位ピニングにより、*i*-GaAs 層内に均一 な内部電場が生じる[6]。この内部電場強度 を光変調反射スペクトルにおいて観測され る Franz-Keldysh 振動解析[7]から,実験的に 11.4 kV/cm と見積もった。内部電場の存在 により,過渡電流および LO フォノン分極 が増大するので, *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造では LOPC モードの観測が有利である。励起光



図 1. *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造における(a)時間領 域テラヘルツ電磁波波形の励起密度依存性 と(b) そのフーリエ変換スペクトル。 Monocycle はモノサイクル信号, LO はコヒ ーレント LO フォノン, LOPC(+) と LOPC(-)はコヒーレント LOPC モードの上 分枝と下分枝をそれぞれ表している。

源にはパルス幅 50 fs, 繰り返し周波数 90 MHz, ピーク波長 800 nm の Ti:sapphire レ ーザーを用い, 試料から放射された THz 電 磁波は、低温成長 GaAs 層上に形成された 光伝導ダイポールアンテナを用いた光ゲー ト法によって検出した。ゲート光強度は10 mW に固定し, 測定は全て室温, 窒素雰囲 気で行った。

3.実験結果と考察

図 1(a)は、時間領域テラヘルツ電磁波波 形の励起密度依存性を示している。テラヘ ルツ電磁波波形に含まれる種々の信号を解 析するためにフーリエ変換を行った。その 結果を図 1(b)に示している。2 THz 付近のブ ロードなバンドは,光生成キャリアによる i-GaAs 層から n-GaAs 層への過渡電流に起 因するモノサイクル信号であり, 8.8 THz の 鋭いバンドはコヒーレント LO フォノンに 起因する信号である。一方,周波数が励起 密度に依存する 2 つのバンドは高周波数側 が LOPC(+), 低周波数側が LOPC(-)からの 信号である。LOPC モード成分を現象論的 にガウス関数でフィッティングし、ピーク 周波数を見積もり, LOPC モード周波数の 電子濃度依存性に関する理論[1,2]に基づく 計算結果と比較したのが図2である。なお, 実験値の電子濃度は励起密度から見積もつ た。LOPC モード周波数の実験値と計算曲 線は良く一致している。ゆえに, LOPC モ ード周波数は光生成キャリア濃度のみによ って決定されると分かる。この事実は, LOPC モードが *i*-GaAs 層で生成されるとい うことを示している。



図 2. *i*-GaAs/*n*-GaAs構造におけるLOPC モー ド周波数の電子濃度依存性の実験値と計算 曲線との比較。□がLOPC(+), △がLOPC(-) の実験値を表しており,実線が計算曲線を 示している。

次に,励起密度 11 μJ/cm²の時間領域波形 を用いて,式(1)で表される時間分割フーリ エ変換による LOPC モードのダイナミクス の解析を行った。ここで, A(t)は時間領域形 の振幅, t,は遅延時間を表している。

$$I(\omega, t_{i}) = \left| \int_{t_{i}}^{6 \operatorname{ps}} A(t) \exp(-i\omega t) dt \right|^{2}$$
(1)

図3は,異なる遅延時間における時間分割 フーリエ変換スペクトルを示している。 LOPCモードは遅延時間150fsでほぼ完全 に消失している。更に,遅延時間の増加に 伴いLOPCモードのピーク周波数が高周波 数側にシフトしていることが確認できる。



図 3. *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造における異なる遅 延時間の時間分割フーリエ変換スペクトル。

まず, LOPC モードの寿命について議論 する。図4は,時間分割フーリエ変換スペ クトルの積分強度の遅延時間依存性を示し ている。○はコヒーレントLOフォノン, □はモノサイクル信号,△はLOPC(-)をそ れぞれ表しており,破線は指数関数による フィッティング曲線である。フィッティン グ結果から求められた寿命はそれぞれコヒ ーレントLOフォノンが0.85 ps,モノサイ クル信号が80 fs,LOPC(-)が60 fs である。 コヒーレントLOフォノンと比較して, LOPC(-)の寿命は1/10以下と非常に短い。 一方,モノサイクル信号と比較すると,寿 命はほぼ同程度である。この事実は,プラ ズモンが過渡電流として作用することを示



図 4. *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造における時間分割 フーリエ変換スペクトルの積分強度の遅延時 間依存性。○はコヒーレントLOフォノン,□は モノサイクル信号,△は LOPC(-)をそれぞれ 表しており,破線は指数関数によるフィッティ ング曲線である。挿入図はより長い時間領域 でのコヒーレントLOフォノンの結果を示してい る。

している。また、LOPC モードの非常に短 い寿命は、電子の *i*-GaAs 層から *n*-GaAs 層 へのエスケープ時間を反映していると考え られる。0.05~1 psの時間領域において、コ ヒーレント LO フォノンの積分強度は減少 し,一方,LOPC(-)の積分強度は部分的に増 加している。このことは、コヒーレントLO フォノンがプラズモンと結合し LOPC モー ドを形成することでコヒーレント LO フォ ノンの積分強度が減少し,相補的にLOPC(-) の積分強度が増加したと考えられる。この 結果は, LOPC モードの結合生成時間の存 在を示唆している。次に、0.1~0.2 psの時間 領域において、一度減少したコヒーレント LOフォノンの積分強度が再び増加し、一方, LOPC(-)の積分強度は急激に減少している。 このことは, LOPC モードの減衰に伴って, コヒーレント LO フォノンが非結合状態と なることを示している。

図 5 は *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造における時間 分割フーリエ変換スペクトルの(a)LOPC(+) および(b)LOPC(-)のピーク周波数の遅延時 間依存性を示している。遅延時間の増加に より, LOPC(-)のピーク周波数が約 1.3 THz, LOPC(+)のピーク周波数が約 0.3 THz 程度



図 5. *i*-GaAs/*n*-GaAs 構造における時間分割 フーリエ変換スペクトルの(a)LOPC(+)と (b)LOPC(-)のピーク周波数の遅延時間依存 性。図中の矢印は試料表面(z=0 nm)におけ る光生成キャリア(電子)濃度に対応する LOPC(+)およびLOPC(-)の周波数を示してい る。

高周波数側にシフトしている。この理由に ついて考察する。光強度は、試料表面から の距離が増大すると,吸収により減少する ので, 光生成キャリア濃度の空間分布も同 様の振る舞いを示す。これを反映し, LOPC モード周波数は試料表面からの距離が増大 すると減少する。従って, 試料表面近傍の 光生成キャリアによる LOPC モードは、相 対的に高い周波数を有し、走行距離を反映 して, *i*-GaAs 層中に相対的に長い時間残留 する。このことが高周波数シフトの原因と 考えられる。試料表面(z=0 nm)における光生 成キャリア(電子)濃度に対応する LOPC モード周波数を計算し、その結果を図5に 矢印で示している。消失直前の遅延時間に おける LOPC(+)および LOPC(-)のピーク周 波数は共に試料表面(z=0 nm)の LOPC モー ド周波数とほぼ一致している。このことか ら, LOPC モードのピーク周波数の遅延時 間依存性は光生成キャリア(電子)の輸送 過程を反映していると結論できる。

まとめ

本研究では, *i*-GaAs(500 nm)/*n*-GaAs エピ タキシャル構造における LOPC モードから のテラヘルツ電磁波放射のダイナミクスを 詳細に調べた。時間分割フーリエ変換スペ クトルの積分強度の遅延時間依存性の解析 から, LOPC モードの寿命を約 60 fs と見積 もった。また, LOPC モードの結合生成時 間の存在と、LOPC モード減衰後にコヒー レント LO フォノンが非結合状態となる現 象を確認した。更に、時間分割フーリエ変 換スペクトルの LOPC モードのピーク周波 数の遅延時間依存性の解析から、遅延時間 の増加に伴う LOPC モードの高周波数側へ のシフトを見出した。これについて、LOPC モード消失直前の遅延時間におけるピーク 周波数が試料表面 (z=0 nm)の光生成キャ リア(電子)濃度に対応する LOPC モード 周波数とほぼ一致することを示した。従っ て, LOPC モードのピーク周波数の時間依 存性は光生成キャリアの輸送過程を反映す ると結論した。

謝辞

本研究は, JSPS 科研費 No. 15K13341 の 助成を受けたものである。

参考文献

[1] I. Yokota, J. Phys. Soc. Jpn. 16, 2075 (1961).

[2] A. Mooradian and G. B. Wright, Phys. Rev. Lett. 16, 999 (1966).

[3] A. Kuznetsov, and C. Stanton, Phys. Rev. B **51**, 7555 (1995).

[4] P. Gu, M. Tani, K. Sakai, T.-R. Yang, Appl. Phys. Lett. **77**, 1798 (2000).

[5] S. Tsuruta, H. Takeuchi, and M. Nakayama, J. Appl. Phys. **113**, 143502 (2013).

[6] H. Takeuchi, J. Yanagisawa, T. Hasegawa, and M. Nakayama, Appl. Phys. Lett. **93**, 081916 (2008).

[7] D. E. Aspnes and A. A. Studna, Phys. Rev. B **7**, 4605 (1973).